10/535332 PCT/DE U 5 / U 3 4 5 7

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

REC'D 17 DEC 2003

WIPO

PCT



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 53 703.8

Anmeldetag:

18. November 2002

Anmelder/Inhaber:

Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung:

Herstellungsverfahren und Schutzschicht für eine

Leuchtstoffschicht

IPC:

G 21 K, G 03 C, G 03 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 15. Mai 2003

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Inc. Auditor

Jm_\Auftrag

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Wallner

A 9161 06/00 EDV-L

Beschreibung

Herstellungsverfahren und Schutzschicht für eine Leuchtstoffschicht

Zur Erzeugung von Röntgenaufnahmen können Leuchtstoffschichten verwendet werden, die als Speicherfolien arbeiten, das heißt die Röntgeninformation speichern. Derartige Speicherfolien werden insbesondere in der digitalen Radiografie und Mammografie eingesetzt. Die Röntgeninformation kommt zustande, indem der zu untersuchende Körper von der Röntgenstrahlung durchlaufen wird. Nach dieser Durchleuchtung trifft die Röntgenstrahlung auf die Speicherfolie, wo sie Veränderungen von in die Speicherfolie integrierten Speicherelementen bewirkt. Die Anzahl der dadurch gesetzten Speicherelemente hängt von der Intensität der auftreffenden Röntgenstrahlung ab. Aufgrund der räumlichen Verteilung der Speicherzellen ü-

ber die Speicherfolie ergibt sich dadurch eine Röntgenaufnah-

me mit der Größe des belichteten Teils der Speicherfolie.

Zur Erzeugung von elektrisch verarbeitbaren oder für das menschliche Auge sichtbaren Bilddaten müssen die Speicherelemente der Speicherfolie ausgelesen werden. Die Inhalte der Speicherelemente sind optisch feststellbar. Zum Auslesen werden sie mit Licht einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt und dadurch optisch angeregt. Ein derart angeregtes Speicherelement emittiert Licht einer bestimmten Wellenlänge, falls es zuvor durch die Absorption von Röntgenstrahlung belegt oder gesetzt wurde. Die Intensität des Emissionslichts hängt dabei von der Anzahl gesetzter Speicherelemente ab und bildet daher ein Maß für die zuvor absorbierte Röntgenstrahlung. Das Emissionslicht ist von verhältnismäßig geringer Intensität und wird daher mit hochempfindlichen Detektoren, z.B. mit Photomultipliern, gemessen.

Zur Erzeugung einer Röntgenaufnahme wird die belichtete Speicherfolie Pixel für Pixel ausgelesen. Aus den ausgelesenen

20

15

5

10

35

30

Informationen werden elektronische oder für das menschliche Auge wahrnehmbare Bilddaten erzeugt. Wegen der optischen Auslesung der Speicherfolie müssen sehr hohe Anforderungen an die Gleichförmigkeit der Folienoberfläche gestellt werden. Defekte in der Speicherfolie wirken sich nicht nur auf die Auslesbarkeit der Speicherfolie aus, sondern auch bereits auf die Belegbarkeit der Speicherzellen durch Röntgenstrahlung. Sie verringern bei beiden Vorgängen die erzielbare Bildqualität. Die erzielbare Bildqualität hängt daher wesentlich von der Defektfreiheit ab.

In röntgendiagnostischen Anwendungen sind Speicherfolien verschiedenen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Zum Beispiel werden sie in Filmkassetten verwendet, um diagnostische Röntgenaufnahmen in der Medizin zu erzeugen. Filmkassetten werden in sogenannten Obertischgeräten verwendet, in denen der zu untersuchende Patient von oben durch Röntgenstrahlung durchleuchtet wird, wobei er auf der Kassette liegt. Dabei übt er einen flächigen Druck auf die Kassette und damit auf die Speicherfolie aus. Die Speicherfolie wird mechanisch strapaziert.

Außerdem führt der Kontakt mit dem Patienten zur Entstehung von Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speicherfolie. Nicht zuletzt muss die Oberfläche von Zeit zu Zeit mit einem flüssigkeitsgetränkten Tuch gereinigt werden, um anhaftende Verunreinigungen zu entfernen, was ebenfalls zur Anlagerung von Feuchtigkeit führt. Die Qualität der Speicherfolie leidet auch unter der Erhöhung der Feuchtigkeit.

Als speichernde Leuchtstoffschichten finden hauptsächlich sogenannte Needle Image Plates (NIP) Verwendung, in denen der Leuchtstoff in nadelförmigen Strukturen auf ein Substrat aufgewachsen ist. Die Nadelspitzen dieser Strukturen enden in der Oberfläche der Speicherfolie und beeinflussen die Röntgenempfindlichkeit und Speicherfähigkeit der Folie. Bei Auflage des zu untersuchenden Patienten oder Objekts auf einer

10

15

20

30

Needle Image Plate werden die in der Oberfläche liegenden Nadelenden mechanisch belastet und können dadurch verformt werden. Unter der Verformung leiden die Röntgenempfindlichkeit und die Speicherfähigkeit. Needle Image Plates bedürfen deswegen eines besonders wirksamen mechanischen Oberflächenschutzes.

Aus der DE 100 48 810 A1 ist es bekannt, die Oberfläche von Needle Image Plates zu schützen, indem eine verformbare Dämpfungsschicht auf die Folienoberfläche aufgebracht wird. Die Dämpfungsschicht bewirkt dabei eine gleichmäßige Verteilung mechanischer Belastungen und muss ihrerseits gegen Kratzer geschützt werden, um nicht an optischer Qualität zu verlieren. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, eine weitere Deckschicht aus SiO2, Al2O3, TiO2 oder aus Silikat aufzubringen. Während die Dämpfungsschicht selbst gute Haftungseigenschaften auf der Needle Image Plate aufweist, treten beim Aufbringen der weiteren Deckschicht Haftungsprobleme mit der Deckschicht auf, die nur durch äußerst aufwändige Herstellungsverfahren zu beheben sind - wenn überhaupt. Soll als Dämpfungsschicht wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften eine Parylen-Schicht (Poly-Para-Xylylen) verwendet werden, ist eine ausreichende Haftung der Deckschicht bislang gar nicht zu erzielen.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Schutzschicht für eine Leuchtstoffschicht für Röntgenaufnahmen anzugeben, die hervorragenden Schutz sowohl gegen mechanische Belastungen als auch gegen Feuchtigkeit bietet, eine gute Schichthaftung aufweist und gleichzeitig unaufwändig und kostengünstig herstellbar ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Herstellungsverfahren für eine solche Schutzschicht anzugeben.

35 Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des ersten Patentanspruchs und durch ein Verfahren mit den Merkmalen des sechsten Patentanspruchs.

Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin, eine polymere Schutzschicht vorzusehen, die gehärtet ist, und zwar lediglich in einem nicht an die Leuchtstoffschicht angrenzenden Bereich. Dabei sollen unter Leuchtstoffschicht sowohl speichernde als auch nichtspeichernde Leuchtstoffschichten verstanden werden. Polymere Schutzschichten haben den Vorteil, dass meist gute Haftungseigenschaften auf Leuchtstoffschichten erreichbar sind. Außerdem sind sie unaufwändig und kostengünstig herstellbar. Weiter ist durch die Härtung des Polymers eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen und gegen Kratzer gewährleistet. Zur Härtung stehen ebenfalls unaufwändige und kostengünstige Verfahren, wie z.B. Elektronenstrahlhärtung, zur Verfügung. Außerdem bildet das Polymer vor allem in dem nicht gehärteten Bereich eine wirksame Barriere gegen Feuchtigkeit. Damit integriert die lediglich teilweise gehärtete polymere Schutzschicht Schutz gegen Feuchtigkeit und gegen mechanische Belastungen und gewährleistet gleichzeitig einen einfachen, haltbaren und unaufwändig herstellbaren Schichtaufbau.

20

15

5

10

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung erfolgt die Härtung des nicht an die Leuchtstoffschicht angrenzenden Bereichs der Schutzschicht durch Elektronenstrahl-Behandlung. Die Elektronenstrahl-Behandlung ist kostengünstig und unaufwändig realisierbar und bietet darüber hinaus den Vorteil, dass über die Parameter des Elektronenstrahls sehr exakt eingestellt werden kann, bis in welcher Tiefe die bestrahlte Schicht behandelt und damit gehärtet wird. Dadurch ist der Bereich der Schutzschicht, der nicht gehärtet werden soll, sehr exakt einstellbar.

30 sehr exakt einstellba

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von Figuren erläutert. Es zeigen:
Figur 1 Schichtaufbau gemäß der Erfindung,

Figur 2 Herstellungsverfahren gemäß der Erfindung.

Figur 1 zeigt einen Schichtaufbau gemäß der Erfindung. Dargestellt ist die Schutzschicht 1, die über der Leuchtstoffschicht 3 liegt. Die Leuchtstoffschicht 3 ist auf ein Substrat 5 aufgebracht, auf das sie aufgedruckt oder aufgedampft werden kann. Es kann sich um eine beliebige Leuchtstoffschicht handeln, in der Erfindung wird eine Needle Image Plate verwendet. Als Speicherleuchtstoffe kommen z.B. CsBr:Eu, RbBr:Tl oder CsBr:Ga zur Verwendung, während als nichtspeichernde Leuchtstoffe z.B. CsI:Na oder CsI:Ti in Frage kämen. Insbesondere die Speicherleuchtstoffe, die vorzugsweise für Needle Image Plates verwendet werden, zählen zu den Alkalihalogeniden und können durch Feuchtigkeit Schaden nehmen.

Bei dem Material der Schutzschicht 1 handelt es sich um ein Polymer mit geeigneten mechanischen und feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften. Vorzugsweise wird eine Parylen-Schicht verwendet, die geeignete Schutzeigenschaften aufweist und durch Temperatur- oder Elektronenstrahl-Behandlung gehärtet werden kann. Besonders geeignet für die Elektronenstrahl-Behandlung sind die drei Parylen-Typen N (Poly-Para-Xylylen), C (Chlor-Poly-Para-Xylylen) oder D (Di-Chlor-Poly-Para-Xylylen). Die Dicke der Parylen-Schicht beträgt 8 bis 80 $\mu \rm m$. Sie kann aufgedruckt, aufgespint (Verteilung des flüssigen Parylen durch Fliehkraft aufgrund von Rotation) oder aufgedampft werden.

Die Schutzschicht 1 weist einen nicht an die Leuchtstoffschicht 3 angrenzenden Bereich 7 und einen angrenzenden Bereich 9 auf. Der nicht angrenzende Bereich 7 ist gehärtet, um eine gegen mechanische Belastungen oder Kratzer resistente Oberfläche zu bilden. Die Härtung kann unaufwändig mittels herkömmlicher Verfahren wie Temperatur- oder Elektronen-Behandlung erreicht werden. Die Temperatur-Behandlung erfordert jedoch Temperaturen von mindestens 200-250 °C, die zur Rekristallisierung der darunter liegenden Leuchtstoffschicht

15

20

30

3 führen würden. Darüber hinaus weist die Temperaturbehandlung den Nachteil auf, dass der Schichttiefenbereich, in dem sie wirkt, nicht gut einstellbar ist. Dies ist nachteilig, da der gehärtete Bereich der Schutzschicht für Feuchtigkeit durchlässiger ist als der nicht gehärtete Bereich. Der Verbleib eines nicht gehärteten Bereichs der Schutzschicht 1 einer Dicke von mindestens 5 μm ist daher essentiell wichtig für den Erhalt der Schutzfunktion gegen Feuchtigkeit. Wegen der besseren Einstellbarkeit der Parameter wird der nicht an die Leuchtstoffschicht 3 angrenzende Bereich 7 daher vorzugsweise durch Elektronenstrahl-Behandlung gehärtet. Die Elektronenstrahl-Behandlung erlaubt die exakte Einstellung der zu behandelnden Schichttiefe. Vorzugsweise weist der behandelte Bereich 7 eine Dicke von mindestens 3 μm auf, um ausreichenden Kratzschutz der Oberfläche zu gewährleisten.

Die Schutzschicht 1 integriert durch den gehärteten Bereich 7 und den nicht gehärteten Bereich 9 Schutz gegen mechanische Belastung und Kratzer und gegen Feuchtigkeit. Gleichzeitig ist sie mit guter Schichthaftung auf die darunter liegende Leuchtstoffschicht 3 aufbringbar und stellt einen besonders einfachen, weil einstückigen, Schichtaufbau dar.

Figur 2 stellt ein Herstellungsverfahren gemäß der Erfindung dar. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Leuchtstoffschicht 3 auf dem Substrat 5 bereits vorliegt. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um eine speichernde oder eine nicht speichernde Leuchtstoffschicht handelt.

Im Verfahrensschritt 11 wird die Oberfläche der Leuchtstoffschicht 3 vorbehandelt, um gute Eigenschaften für die Abscheidung der Schutzschicht 1 aufzuweisen. Die Vorbehandlung erfolgt durch sogenanntes Plasma-Ätzen, bei dem die Oberfläche mit Ionen aus einem Plasma beschossen wird. Diese Plasma-Behandlung sorgt zum einen für eine Reinigung der Oberfläche 35 auf atomarer bzw. molekularer Ebene, zum anderen bewirkt sie

10

15

20

30

35

eine Mikro-Aufrauung der Oberfläche, die eine gute Schichthaftung begünstigt.

In einem anschließenden Verfahrensschritt 13 wird die polymere Schutzschicht 1 abgeschieden. Als Abscheidungsverfahren kommen Druck-, Spin- oder Aufdampfverfahren in Frage. Vorzugsweise wird ein Chemical Vapor Deposition-Verfahren (CVD) verwendet. Das CVD-Verfahren kann nötigenfalls physikalisch, z.B. durch Wärme, unterstützt werden (Physically Enhanced CVD, PECVD-Verfahren). CVD-Verfahren gewährleisten hervorragende Schichthaftung und Schichteigenschaften.

Im abschließenden Verfahrensschritt 15 wird die Schutzschicht 1 mittels Elektronenstrahl behandelt. Dabei wird ein Elektronenstrahl bestimmter Energie mit einer bestimmten Geschwindigkeit über die Oberfläche der Schutzschicht 1 bewegt. Die Parameter des Elektronenstrahls und seiner Bewegung über die Schutzschicht beeinflussen die Dicke des Bereichs 7 der Schutzschicht 1, der behandelt wird. Die Elektronenstrahlbehandlung bewirkt eine Härtung der Schutzschicht 1 und erhöht deren Kratzfestigkeit.

In einem **ersten Beispiel** wird eine Parylen-Schicht vom Typ N mit einer Gesamtdicke von 50 μ m behandelt. Dazu wird ein Elektronenstrahl von 40 keV mittels einer elektromagnetischen x-y-Ablenkung über die Parylen-Schicht bewegt. Die Geschwindigkeit es Elektronenstrahls wird so eingestellt, dass die obersten 20 μ m der Schicht gehärtet werden. Da eine Vielzahl weiterer Größen die Tiefe des behandelten Bereichs 7 beeinflusst, ist die Geschwindigkeit des Elektronenstrahls nicht exakt vorgebbar, sondern muss experimentell ermittelt werden.

In einem zweiten Beispiel wird eine Parylen-Schicht vom Typ C mit einer Gesamtdicke von 30 μ m behandelt. Dazu wird ein Elektronenstrahl von 25 keV mittels x-y-Ablenkung so schnell über die Schicht bewegt, dass die obersten 5 μ m gehärtet werden.

In einem **dritten Beispiel** wird eine Parylen-Schicht vom Typ D mit einer Gesamtdicke von 20 μm durch einen Elektronenstrahl von 15 keV so behandelt, dass die obersten 10 μm gehärtet werden.

5

In einem **vierten Beispiel** wird eine Parylen-Schicht vom Typ C mit einer Gesamtdicke von 8 μ m durch einen Elektronenstrahl von 5 keV so behandelt, dass die obersten 3 μ m gehärtet werden.

10

Für die Bewegung des Elektronenstrahls relativ zur Schutzschicht kann neben einer elektromagnetischen Ablenkung des Elektronenstrahls beispielsweise auch ein mechanischer Vorschub der Schicht eingesetzt werden.

Patentansprüche

- 1. Bilddetektor für ein Röntgenbild mit einer Leuchtstoffschicht (3) und einer darüber liegenden polymeren Schutzschicht (1) dad urch gekennzeich net, dass die Schutzschicht (1) in einem nicht an die Leuchtstoffschicht (3) angrenzenden Bereich (7) gehärtet ist.
- 10 2. Bilddetektor nach Anspruch 1
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der gehärtete Bereich (7) der Schutzschicht (1) durch Elektronenstrahl-Behandlung gehärtet ist.
- 3. Bilddetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (1) aus Poly-Para-Xylilen besteht.
- 4. Bilddetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche 20 dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtstoffschicht (3) eine Needle Image Plate ist.
 - 5. Bilddetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtstoffschicht (3) aus Alkalihalogeniden oder Erdalkalihalogeniden besteht, z.B. aus CsBr:Eu, BaFBr:Eu, RbBr:Tl, CsBr:Ga, CsI:Na oder CsI:Tl.
- 6. Verfahren zur Herstellung einer polymeren Schutzschicht
 30 (1) auf einem Bilddetektor für ein Röntgenbild, der eine
 Leuchtstoffschicht (3) aufweist, wobei in einem ersten Verfahrensschritt (13) die Schutzschicht (1) auf der Leuchtstoffschicht (3) abgeschieden wird und in einem zweiten Verfahrensschritt (15) ein nicht an die Leuchtstoffschicht (3)
 35 angrenzender Bereich (7) der Schutzschicht (1) gehärtet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Härtung in dem zweiten Verfahrensschritt (15) durch Elektronenstrahl-Behandlung erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7 dad urch gekennzeichnet, dass die Leuchtstoffschicht (3) in einem dem ersten Verfahrensschritt (13) vorangehenden Verfahrensschritt (11) durch eine Plasma-Behandlung vorbehandelt wird.

10

15

20

Zusammenfassung

Herstellungsverfahren und Schutzschicht für eine Leuchtstoffschicht

Die Erfindung betrifft eine Schutzschicht für einen Bilddetektor für ein Röntgenbild. Der Bilddetektor weist eine Leuchtstoffschicht (3) auf, die gegen mechanische Belastung und Feuchtigkeit zu schützen ist. Darüber liegt eine polymere Schutzschicht (1). Gemäß der Erfindung ist die Schutzschicht (1) gehärtet, und zwar lediglich in einem nicht an die Leuchtstoffschicht (3) angrenzenden Bereich (7). Der gehärtete Bereich (7) bietet Schutz gegen mechanische Belastung, während der verbleibende Bereich eine Barriere gegen Feuchtigkeit bildet. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer polymeren Schutzschicht (1) auf einem Bilddetektor für ein Röntgenbild, der eine Leuchtstoffschicht (3) aufweist. Gemäß der Erfindung wird in einem ersten Verfahrensschritt (13) die Schutzschicht (1) auf der Leuchtstoffschicht (3) abgeschieden und in einem zweiten Verfahrensschritt (15) gehärtet, und zwar lediglich in einem nicht an die Leuchtstoffschicht (3) angrenzenden Bereich (7).

FIG 1

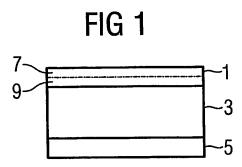


FIG 2

